

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第2区分
 【発行日】平成18年12月28日(2006.12.28)

【公表番号】特表2006-507345(P2006-507345A)
 【公表日】平成18年3月2日(2006.3.2)
 【年通号数】公開・登録公報2006-009
 【出願番号】特願2004-555427(P2004-555427)
 【国際特許分類】

C 0 7 D 213/38 (2006.01)

C 0 8 F 4/70 (2006.01)

C 0 7 F 15/02 (2006.01)

【F I】

C 0 7 D 213/38

C 0 8 F 4/70

C 0 7 F 15/02 C S P

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月6日(2006.11.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

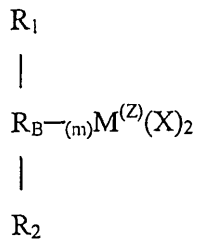
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式

【化3】



(ここで、Mは3d、4d又は5dの遷移金属であり；各XはMに結合した原子または基であり、そして同一であるかあるいは異なっており；R₁およびR₂は同一、あるいは異なっており、そして置換あるいは非置換のシクロペンタジエニル基であり；R_BはR₁およびR₂の間の構造的架橋であり、そしてMに結合する3つのヘテロ原子を含んでなり、R₁およびR₂の各々はR_Bの同一の、あるいは異なるヘテロ原子に結合し、ヘテロ原子は又Mにも結合し；ZはMの配位数であり、そして4よりも大きいか、あるいは4に等しく；mはMとR_Bのヘテロ原子の間の結合数であり、そしてm≧2であり；そしてR₁、R₂およびR_BはC₁、C₂あるいはC_s対称性を付与するように選択される)
 を含んでなる触媒系。

【請求項2】

ヘテロ原子がO、N、S、およびPからなる群から選択される請求項1に記載の系。

【請求項3】

R₁が前記ヘテロ原子の1つに結合し、そしてR₂が前記ヘテロ原子の異なる1つに結合する請求項1に記載の系。

【請求項4】

Mが本質的にFe、CoおよびNiからなる群から選択される請求項1に記載の系。

【請求項5】

MがFeであり、そしてR₁が前記3個のヘテロ原子の1つに結合し、そしてR₂はR₁が結合するヘテロ原子と異なるヘテロ原子に結合し；

MがFe、CoおよびNiから選択される請求項1に記載の系。

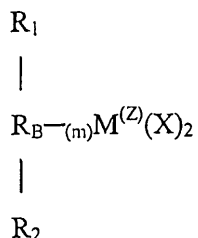
【請求項6】

各Xがハライドおよび置換あるいは非置換の炭化水素からなる群から独立に選択される請求項5に記載の系。

【請求項7】

賦活剤を式

【化4】



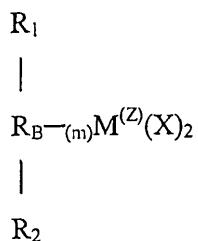
(ここで、Mは3d、4d又は5dの遷移金属であり；各XはMに結合した原子または基であり、そして同一であるかあるいは異なり；R₁およびR₂は同一であるか、あるいは異なり、そして置換あるいは非置換のシクロペンタジエニル基であり；R_BはR₁およびR₂の間の構造的架橋であり、そしてMに結合する3個のヘテロ原子を含んでなり、R₁およびR₂の各々がR_Bの同一の、あるいは異なるヘテロ原子に結合し、ヘテロ原子はMにも結合し；ZはMの配位数であり、そして4よりも大きいか、あるいは4に等しく；mはMとR_Bのヘテロ原子の間の結合数であり、そしてm ≥ 2であり；そしてR₁、R₂およびR_Bが触媒成分にC₁、C₂あるいはC_s対称性を付与するように選択される)

を有する架橋化合物と接触させることを含んでなる触媒系を製造する方法。

【請求項8】

式

【化5】



(ここで、Mは3d、4d又は5dの遷移金属であり；各XはMに結合した原子または基であり、そして同一であるかあるいは異なり；R₁およびR₂は同一、あるいは異なり、そして置換あるいは非置換のシクロペンタジエニル基であり；R_BはR₁およびR₂の間の構造的架橋であり、そしてMに結合する3個のヘテロ原子を含んでなり、R₁およびR₂の各々はR_Bの同一の、あるいは異なるヘテロ原子に結合し、ヘテロ原子はMにも結合し；ZはMの配位数であり、そして4よりも大きいか、あるいは4に等しく；mはMとR_Bのヘテロ原子の間の結合数であり、そしてm ≥ 2である)

を含んでなる触媒系。